

Высокочистый Лабораторный Очиститель Газа Для Инертной Атмосферы И Сверхчистых Технологических Газов

Артикул: КТ-ЈН



введение

Откройте для себя наш лабораторный очиститель газа высокой чистоты, разработанный для непрерывной подачи сверхчистого инертного газа. Эффективно удаляя влагу и кислород до уровня ниже ppm, эта система обеспечивает абсолютную целостность атмосферы для требовательных установок CVD, синтеза полупроводников и передовых металлургических исследовательских центров.

[Узнать больше](#)

Область применения	Описание	Ключевое преимущество
Полупроводники и эпитаксия тонких пленок	Подает сверхчистый аргон или азот в качестве газа-носителя непосредственно в камеры CVD, PECVD и ALD во время обработки пластин.	Предотвращает окисление подложки, минимизирует точечные дефекты и обеспечивает высокую однородность пленки на тонких атомарных слоях.
Термическая обработка в инертной атмосфере	Очищает потоки защитного газа для трубчатых печей, печей с вакуумно-защитной атмосферой и стоматологических установок спекания при обработке активных сплавов.	Устраняет образование окалины и обезуглероживание поверхности титана, циркония и тугоплавких суперсплавов при высокотемпературной обработке.
НИОКР в области литевых и твердотельных аккумуляторов	Подготавливает защитную атмосферу в перчаточных боксах, на линиях сборки пакетированных элементов и станциях приготовления электролита.	Защищает чувствительные к влаге аноды из металлического лития и химические составы твердых электролитов от критической деградации под воздействием влаги.
Производство оптического волокна и фотовольтаики	Очищает технологическую атмосферу при вытяжке заготовок, выращивании слитков кремния и нанесении пассивированных контактных слоев на пластины.	Предотвращает